

<https://www.spst-photopolymer.org>

講演募集

ICPST-42

第42回国際フォトポリマーコンファレンス

リソグラフィ、ナノテクノロジー、フォトテクノロジー
-材料とプロセスの最前線-

2025年6月24日 (火)～27日 (金)

アクリエ姫路

主催 フォトポリマー学会 (SPST)

協賛 フォトポリマー懇話会、日本化学会、高分子学会
応用物理学会



第42回国際フォトポリマーコンファレンスを下記の要領で開催いたします。
フォトポリマーに関心をお持ちの方々は是非、御参加下さい。

日 時 2025年6月24日(火)～27日(金)

会 場 兵庫県姫路市神屋町143-2
アクリエ姫路(JR 姫路駅下車徒歩15分)
詳細は学会ホームページでご案内します。

講演内容

フォトポリマーに関する科学と技術の研究報告

A. 英語シンポジウム

- A0. Plenary Talk
- A1. Next Generation Lithography, EB Lithography and Nanotechnology
- A2. Nanobiotechnology
- A3. Directed Self Assembly (DSA)
- A4. Computational / Analytical Approach for Lithography Processes
- A5. EUV Lithography
- A6. Nanoimprint
- A7. 193 nm Lithography Extension
- A8. Photopolymers in 3-D Printing/ Additive Manufacturing
- A9. Strategies and Materials for Advanced Packaging, Next Generation MEMS, Flexible Devices
- A10. Chemistry for Advanced Photopolymer Science
- A11. Organic and Hybrid Materials for Photovoltaic and Optoelectronic Devices
- A12. Fundamentals and Applications of Biomimetics Materials and Processes
- A13. Polyimides and High Thermally Stable Resins
- A14. General Scopes of Photopolymer Science and Technology
- P. Panel Symposium

B. 日本語シンポジウム

- B1. ポリイミド及び高温耐熱樹脂-機能化と応用
A14と併設開催(英語発表を希望の場合A14に申し込みをお願いします)
- B2. プラズマ光化学と高分子表面機能化
- B3. 一般講演:(1) 光物質化学の基礎(光物理過程、光化学反応など)、
(2) 光機能素子材料(分子メモリー、情報記録材料、液晶など)、
(3) 光・レーザー電子線を活用する合成・重合・パターンニング、
(4) フォトファブリケーション(光成型プロセス、リソグラフィ)、
(5) レジスト除去、エッチング、洗浄、(6) 装置(光源、照射装置、計測、プロセスなど)

C. チュートリアルセッション

作成中

講演時間と言語

原則として討論時間を含め20分。英語シンポジウムは英語、日本語シンポジウムおよびチュートリアルセッションは日本語および英語発表です。

講演申込

学会ホームページ (<https://www.spst-photopolymer.org/>) [講演募集ICPST-41→日本語会場発表申し込み]からお申し込みください。

講演申込締切

2025年2月14日(水)

論文の出版

ICPST-42の論文はJournal of Photopolymer Science and Technology Vol. 38 (2025) にJournal基準による審査を経て出版されます。論文原稿は、完全原稿を作成し、2025年4月1日(月)までに学会ホームページ (<https://www.spst-photopolymer.org/>) の [Journal→Submission&Reviewing of MS] に投稿してください。

フोटポリマー学会出版局

〒599-8531 大阪府堺市中区学園町1-1
大阪公立大学大学院工学研究科応用化学分野 岡村晴之
Tel: 072-254-9291, Fax: 072-254-9291
E-mail: okamura@omu.ac.jp

会費(参加費に充当、ICPST-42の参加およびそのジャーナルを含む) (非課税)

すべての参加者(講演者を含む)は会費をお支払いください。

	5月31日以前	6月1日以降
一般	65,000 円	80,000 円
学生	10,000 円	15,000 円
懇親会	5,000 円	5,000 円

※昨今の物価高騰および継続的な運営を考慮して、会費を設定しています。

参加登録方法

講演者を含む全参加者はフォトポリマー学会のホームページ (<https://www.spst-photopolymer.org>/講演募集icpst-42-2024/参加登録/)より登録ください。

展示会

コンファレンス期間中展示会を併設します。展示会出展企業を募集いたします。事務局に申し込みまたはお問い合わせ下さい。

第42回 国際フォトポリマーコンファレンス事務局

〒564-8680 大阪府吹田市山手町3-3-35
関西大学 化学生命工学部 工藤 宏人
Tel 06-6368-1977, Fax 06-6368-1977
E-mail: kudoh@kansai-u.ac.jp

フォトポリマー学会 (SPST)

会長：	渡邊健夫
副会長：	早川晃鏡
副会長：	永原誠司
国際会議実行委員長：	早川晃鏡
国際学術誌出版委員長：	岡村晴之
国際学術賞選考委員長：	尾坂 格
事務局長：	工藤宏人

ICPST-42 組織委員会

委員長：渡邊健夫
委員：津田 穰，遠藤政孝，一木隆範，曾我公平，永原誠司，早川晃鏡，
瀬下武広，大澤壮祐，吉元健治，渡邊健夫，工藤宏人，平山 拓，
山川進二，平井義彦，谷口 淳，竹井 敏，栗原一真，河合義夫，上野 巧，
竹井邦晴，唐津 孝，岡村晴之，渋谷明規，大北英生，尾坂 格，
眞山博幸，関口 淳，室崎喬之，荒木 斉，宮尾憲治，近藤伸一，
堀邊英夫，山本雅史， Choong Bong Lee

<https://www.spst-photopolymer.org>

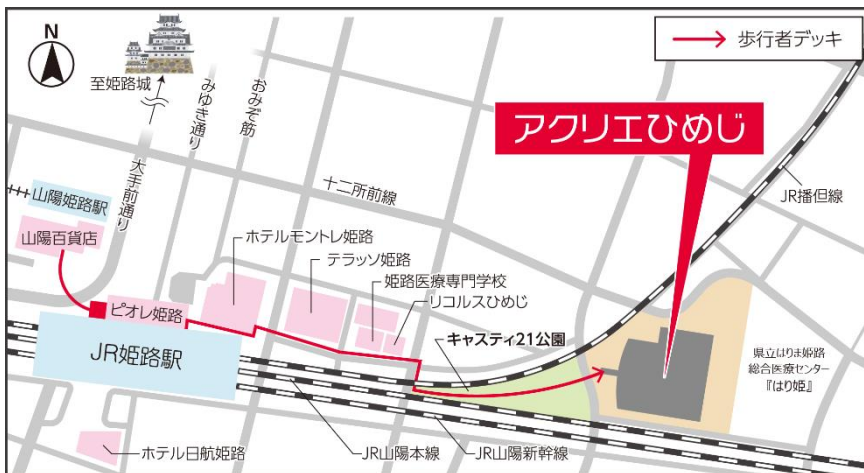
アクリエ姫路

アクリエ姫路は姫路市に位置するコンベンションセンターで、JR姫路駅から徒歩10分です。

[姫路市 | アクリエひめじ \(姫路市文化コンベンションセンター\)](#)



姫路駅からアクセス



新幹線、在来線、私鉄、バスなどが集結する姫路駅から徒歩10分

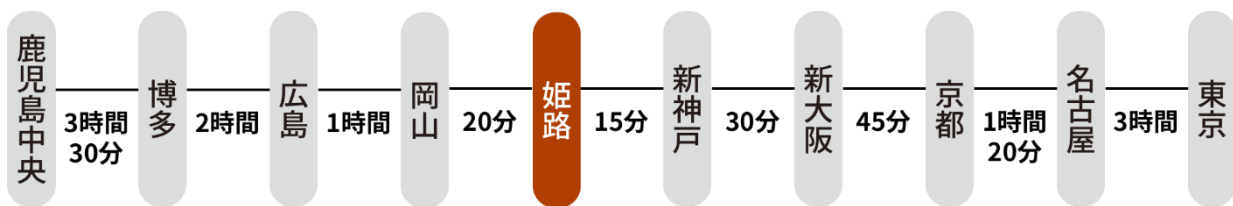
電車でのアクセス



- 電車でお越しの場合

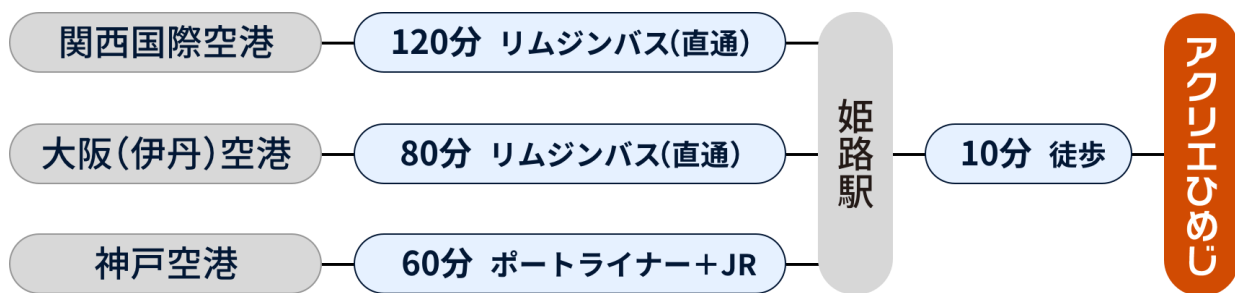
新幹線「のぞみ」停車駅。東京駅から施設エントランスまで最短3時間10分。

「乗換なし」×「駅近」＝「ストレスフリー」



- JR在来線
- ・大阪方面から約60分・・・新快速：大阪駅→（20分）→三ノ宮駅→（40分）→姫路駅
- ・岡山方面から約85分・・・普通：岡山駅→（約65分）→相生駅→（約20分）→姫路駅

飛行機でお越しの場合



- ・関西国際空港から約130分・・・空港から直通リムジンバス→（120分）→姫路駅
- ・大阪（伊丹）空港から約90分・・・空港から直通リムジンバス→（80分）→姫路駅
- ・神戸空港から約70分・・・空港からポートライナー+JR→（60分）→姫路駅

宿泊情報

JR姫路駅周辺に以下のとおりホテルが多数ございます。

ホテル日航姫路、リッチモンドホテル姫路、姫路キャッスルグランヴィリオホテル、ドーミーイン姫路、ホテルモンレー姫路、東横イン新幹線姫路駅南口、東横イン新幹線姫路駅北口、APA ホテル姫路駅北、JRクレメントイン姫路、天然温泉リブマックスPREMIUM姫路駅南、ダイワロイネットホテル姫路、ホテルウィングインターナショナル姫路、コンフォートホテル姫路、ホテルクラウンヒルズホテル姫路、姫路駅前ユニバーサルホテル南口、ホテルリブマックス姫路駅前、ホテルファース姫路、ホテルアルファワン姫路南口、姫路グリーンホテル立町、姫路城下町ホテルクレール日笠